

中国における技術ライセンス及びR&Dの実態調査

ライセンス委員会*
第1小委員会

抄録 2002年1月の中華人民共和国技術輸出入管理条例（いわゆる「新条例」）の施行をはさんで過去2回、中国におけるライセンス規制の実態につきアンケートを実施し調査を行ってきた^{1) 2)}が、さらに2年が経過し、新条例の運用が定まってきたと思われる現状について、前回同様の項目につき「定点観測」としてのアンケートを実施した。また、今回は、今日の日本企業の中国進出が単なる「製造拠点としての進出」とどまらず「R&D拠点としての進出」の側面も持ち始めているのではないか、との仮定の下、それを検証すべく新たな項目を追加してアンケートを実施した。これらのアンケート結果とその内容につき検討を行った結果をここに報告する。

目次

1. はじめに
2. アンケートの方法
3. 技術ライセンスについて
 3. 1 中国における技術ライセンスの状況
 3. 2 ライセンスの相手先・交渉の進め方等
 3. 3 まとめ
4. R&Dの実態について
 4. 1 中国でのR&D活動の動向
 4. 2 R&D拠点について
 4. 3 R&D契約について
 4. 4 まとめ
5. おわりに

1. はじめに

2002年1月、中国政府は、WTO加盟にあわせ、「技術導入契約管理条例」（1985年5月24日国務院公布）（以下「旧条例」という）及び「技術導入契約管理条例施行細則」（1988年1月20日対外経済貿易部公布）を廃止すると同時に、新たに「中華人民共和国技術輸出入管理条例」（2001年12月10日国務院公布）（以下「新条例」という）を施行した。当委員会では、新条例の

施行をはさみ前後にアンケートを実施し、中国政府によるライセンス規制の問題点が新条例の施行により改善されたか否か、その動向を調査した。しかしながら、2003年の前回調査時には、未だ新条例の施行から2年程度しか経過していないこともあり、新条例の規程内容がきちんと実務に浸透し運用レベルでの不当な制限は姿を消しているか、という点につき必ずしも明確ではない事項も存在した。今回、さらに2年が経過した2005年時点において、同様の項目につきアンケートを実施し、過去との比較を行うことにより、新条例に謳われたライセンス規制の緩和・撤廃がまさしく額面通り運用レベルにおいても達成されているか否かを明らかにするとともに、今日の日本企業の中国ライセンスに対する意識の変化（中国へのライセンスの質・量的変化及び重要性の動向、秘密保持その他の留意点に関する意識等）を「定点観測」視点より分析することを企図した。

また、今回は従来の「技術ライセンスの規制」に関するアンケートに加え、日本企業の中国に

* The First Subcommittee, License Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

におけるR&D活動についてのアンケートを実施した。これは、今日、日本企業は、中国への進出、特に技術進出に、従来の「製造拠点」としてのみならず「研究開発（R&D）の拠点」としての役割を期待する傾向が強まってきているのでは、という当委員会内に生じた仮説に基づき、これを検証することを目的の一つとしている。また、この検証作業を通じ、今日の日本企業の中国への技術進出の実態を探り出すことを企図している。

なお、本調査は、2005年度及び2006年度ライセンス委員会第1小委員会メンバーによって行われ、2006年度のメンバーにより本稿としてまとめられた。

2. アンケートの方法

(1) アンケート実施時期

2005年11月

(前回調査：2003年11月)

(2) 調査対象会社～業種

2005年度ライセンス委員会所属会社及び専門委員会所属会社(ライセンス委員会未所属会社)計223社にアンケートを送付し、93社から回答を得た(回答率42%)。

業種別の内訳は、電機、電子・通信分野が24社(26%)、化学、医薬・化粧品分野が23社(25%)、機械、輸送用機械分野が21社(23%)、鉄鋼・金属、その他分野が25社(27%)であった。

(3) 調査方法及び内容

電子メールによるアンケートを実施した。前回とほぼ同じ質問項目からなる「技術ライセンスの規制」についての質問を2004年1月以降に締結されたライセンス契約について行うとともに、新たに「貴社における中国R&Dについて」と題して質問を行った。また、2006年8月に一部の項目につき、追加調査を行った。以下、そ

れぞれについて概要を紹介する。

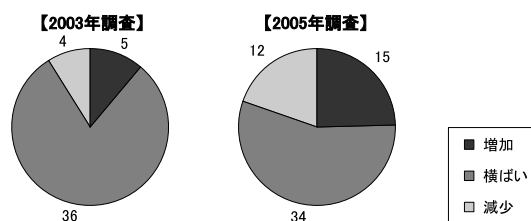
3. 技術ライセンスについて

3.1 中国における技術ライセンスの状況

(1) ライセンス件数の動向

2004年1月以降のライセンス契約締結件数の動向は、図1に示す通り、「増加」が25%、「減少」が20%であった。2003年の前回調査の結果がそれぞれ11%、9%であったことと比較して、今回、増加も減少も増えている結果となった。

質問1. ライセンス件数の動向は？



注) 各図に付記の数値は件数(以下同様)

図1

(2) ライセンス件数の今後の予測

今後のライセンス件数の動向の予測は、図2に示す通り、「増加」が41%、「増加」と「横ばい」の合計が90%であり、前回調査と同様の傾向を示している。今後も少なくとも現在と同じ水準以上で中国へのライセンスは続く、という認識に立っている企業が多いと思われる。

質問2. ライセンス件数の今後の予測は？

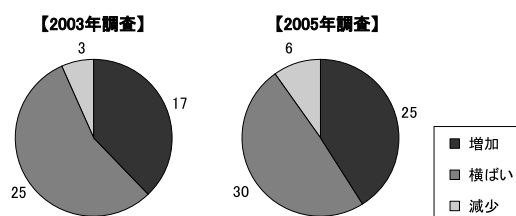


図2

(3) 事業進出を伴うライセンスの有無

自社の事業進出を伴うライセンス契約の締結の有無は、図3に示す通り、「契約あり」が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

47%、「契約なし」が53%であった。前回調査の結果がそれぞれ51%、49%であったことと比較して、今回、特に変化が見られなかった。

質問3. 中国へ事業進出した企業の内、ライセンス契約を伴うものは？

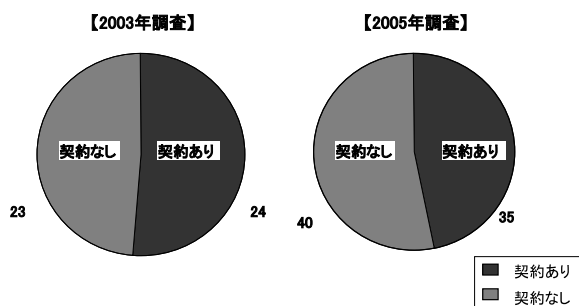


図3

(4) 事業進出を伴わないライセンスの有無

自社の事業進出を伴わないライセンス契約の締結の有無は、図4に示す通り、「契約あり」が31%、「契約なし」が69%であった。前回調査の結果がそれぞれ21%、79%であったことと比較して、今回、増加傾向が見られた。

以前に比べ、事業進出、すなわち現地子会社での事業展開の有無にこだわらず、中国メーカーより引き合いのある技術（もっとも、最先端の技術は出せない場合が多いであろう）のライセンスにも積極的になりつつあることに加え、製品メーカーの中国への事業進出に伴って、部品、原料メーカーが（自社では事業進出せず）

質問4. 自社の事業進出に関わりなく、ライセンス契約を締結しましたか？

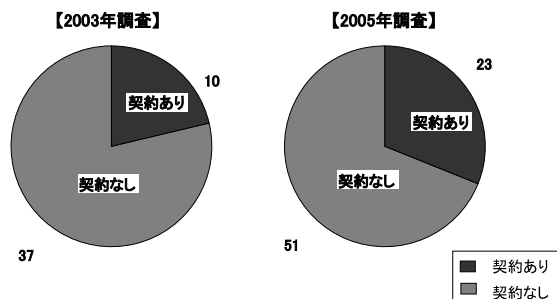


図4

中国のメーカーへのライセンスを行うケースも現実には存在するようである。

3.2 ライセンスの相手先・交渉の進め方等

(1) ライセンスの相手先

地域別のライセンス件数は、多い順に江蘇省（17件）、上海市（16件）、広東省（14件）、浙江省（10件）、北京市（8件）となっており、従来の調査と同様に、引き続き沿海部大都市へのライセンスが活発に行われている。

また、相手先の資本形態については、図5に示す通り、出資比率50%超の中国の国営企業との合弁企業へのライセンスが16%から3%へと減少し、100%子会社へのライセンスが14%から31%へと急増している。前回調査と比較して、ライセンスの相手先が中国国営企業関係から、自社の子会社へと、大きな変化が出ていることがわかる。この理由としては、2000年に中国の外資独資企業法が改正されて以後、外資独資子会社の設立が広く認められるようになった（業種によって時期は異なる）ことが考えられる。

質問5. ライセンスの相手先の種類は？

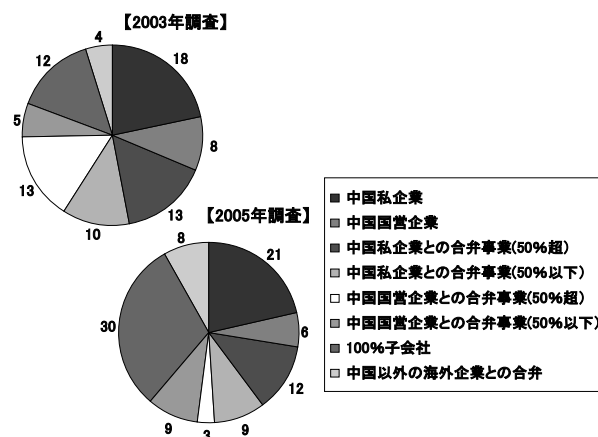


図5

(2) ライセンスの種類（対象知財）

図6に示す通り、特許や商標等の複合型だったライセンス契約が55%から25%へと減少する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一方、「特許+ノウハウ」型が18%から43%へと増加するとともに、「意匠、商標のみ」のライセンス契約が0%から5%へと増加した。上記3. 1. (4) に示した通り、事業進出を伴わないライセンスが増えたこともあり、技術ライセンスに必ずしも商標ライセンスを伴わなくなったこと、及び2002年1月に新条例が施行され、旧条例時に存在した「技術導入契約の契約期間が10年を超えてはならない」、「ライセンシーによる契約終了後のノウハウの継続使用禁止条項を契約中に含めることができない」との定めがなくなったこと、等がノウハウを含む技術単独のライセンスが増えた理由として考えられる。

質問6. ライセンスの種類(対象となる知財)は?

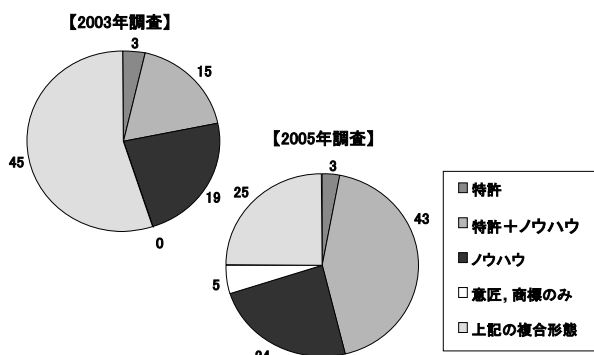


図6

(3) ライセンスの動機

ライセンスの動機については大きな変化が出ている。図7に示す通り、「中国政府、自治体の要望」に基づくライセンスという、いわば受身型のライセンスが21%から11%へと大きく減少し、逆に「コストダウン」や、「親会社、関連会社等の進出に伴うもの」、「原材料、消耗品、予備品の供給の便」を目的とするといった、本来の戦略目的に基づくものが併せて32%から53%へと大きく増加している。上記3. 1. (4) に述べたような、製品メーカーの中国への事業進出に伴って、部品、原料メーカーが中国のメーカーへのライセンスを行うケースもこれに含

まれるものと考えて良いであろう。

質問7. ライセンスの動機は?

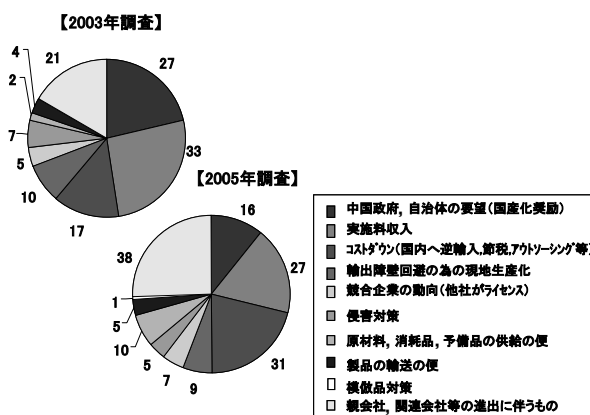


図7

(4) 準拠法

契約解釈のための準拠法については、図8に示す通り、「日本法」が24%から46%へと増加し、「中国法」(52%→43%), 「その他(第三国等)」(23%→11%)がその分それぞれ減少している。上記3. 2. (1) に示したように、自社の子会社へのライセンスが増加していることが日本法準拠の増加の理由として挙げられよう。

質問8. ライセンス契約の準拠法は?

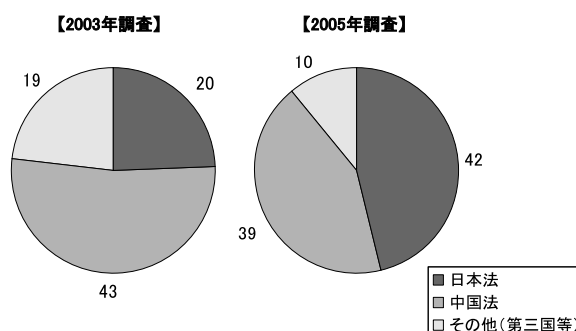


図8

(5) 内規の存在示唆

交渉時に内規が存在することを示唆されたことがあるかを確認したところ、図9に示す通り、12%から「ある」との回答が寄せられた。旧条例時には、「実施料率は純販売価格の5%以内

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とする」等の「技術導入契約の締結及び審査認可の指導原則」³⁾（対外経済貿易部1990年1月22日公布・施行）が1993年4月28日の廃止以後も事実上の効力を有していた⁴⁾との情報があり、今回の調査でも同様の内規の存在を示唆されたとの回答があった。

質問9. 内規の存在を示唆されたことがありますか？

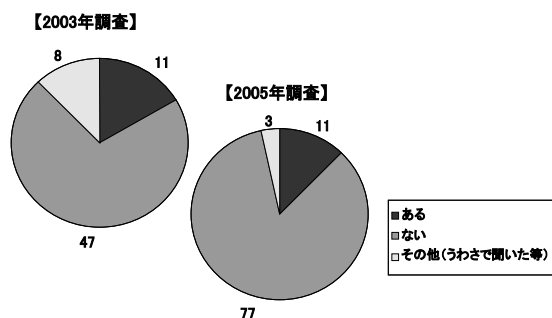


図9

(6) 登録までの期間

申請から登録までどれだけ期間がかかったかを確認したところ、図10に示す通り、「6ヵ月未満」が76%、「6ヵ月～1年未満」が13%、「1年～2年未満」が11%、「2年以上」は0%という結果を得た。大多数を占める「6ヵ月未満」について追跡調査を行ったところ、「1ヵ月未満」が6割を占めた。中国技術輸出入契約登録管理弁法によると、「自由技術」については申請から登録完了までは3日との定めがあるが、日本側で登録完了を確認するまでの期間等

質問10. 申請から登録までに掛かった期間は？

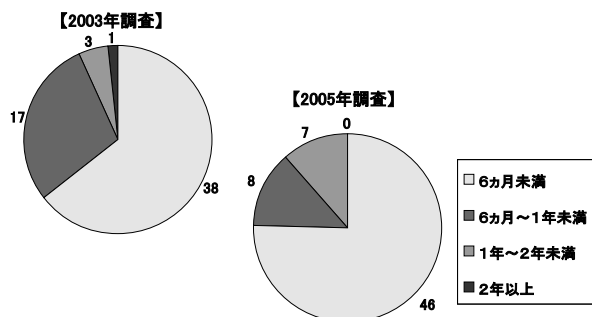


図10

を考慮すれば、この6割については、概ね問題ないと言っても良いかと思われる。一方で前回調査の36%から減少したとはいえ、6ヵ月以上を要する案件が依然24%（15件）もあるという実態が明らかになった。

(7) 「自由技術」の審査及び地方行政機関からの指導

「自由技術」についてライセンスした案件につき契約審査がなされたかを確認した。

図11に示す通り、計79件の回答中、「自由技術」についての審査が「ある」との回答は8%あり、前回調査時（11%）よりやや減少した。

今回、「地方行政機関からの指導の有無」についても調査を行ったが、図12に示す通り、8%と僅かながら指導が「ある」との回答が得られたことから、地域によっては「自由技術」

質問11. 「自由技術」のライセンス契約について審査がなされましたか？

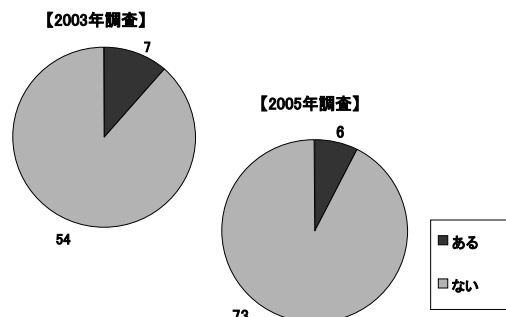


図11

質問12. 地方行政機関から指導はありましたか？

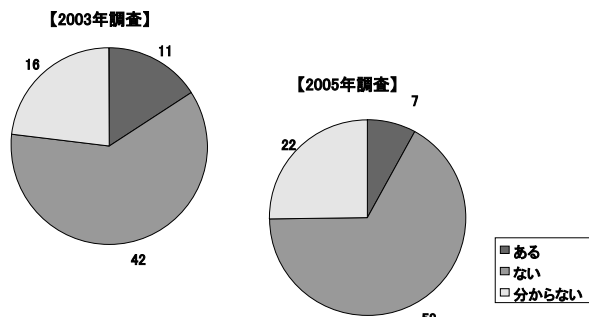


図12

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

といえども依然指導が行われていることが窺われる。

さらに、審査の内容について追跡調査したところ、「ロイヤルティ率を下げさせられた」、「契約期間を「権利存続期間」ではなく、明記するよう求められた」との例があった。自ら問合せをしたため指導された等、必ずしも審査とはいえないケースもみられた。

(8) 実施料の支払い方法

どのような方法で実施料の支払いを受けたかを確認したところ、**図13**に示す通り、最も多かったのは、「ランニングのみ」(55%)である。前回調査時も「ランニングのみ」が55%を占めており、ライセンス導入失敗時のリスクヘッジを望むライセンシーの意向と経営の安定に資するため定期的な実施料収入を望むライセンサーの意向とを反映しているものと思われる。

他方、「一括払い」(20%)が前回調査時から10ポイント増加している。実施料が少額である等の理由から実施料授受に要するコストの抑制を望む両当事者の意向を反映したものと考えられる。また、ライセンス契約締結後に実施料支払いの遅延が問題となる事例が報告されていることから、実施料支払いの遅延を危惧するライセンサーの意向をも反映しているものと推察される。

質問13. 実施料の支払い方法は？

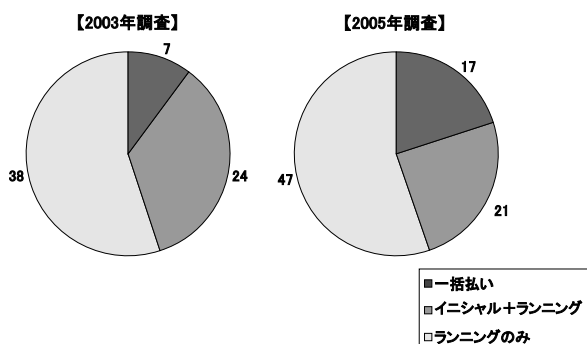


図13

なお、旧条例時のように支払い方法に対する指導がなされている形跡は、今回の調査結果からは読み取れない。純粋に交渉の成果と考えるべきであろう。

(9) ランニングの場合の実施料率

ランニングの場合の実施料率の範囲について確認したところ、最も多かったのは、「3%未満」(46%)である。他方、旧条例時に内規で規制されていたとされる5%以上の実施料率を採用したケース(21%)が前回調査時から10ポイント増加しており、旧条例時に存在したとされる内規はもはやほぼ影響力を失ったと言って良いであろう。

他方、今回の調査では、実施料率の規制がライセンス契約締結に際して問題となった、との報告が4件なされており、未だ実施料率に関する問題が皆無となったとまでは言えないようである(下記3. 2. (11)参照)。

(10) ノウハウライセンスの情報漏洩防止義務

ノウハウライセンスにおいて特に情報漏洩防止の義務を課しているかを確認したところ、**図14**に示す通り、最も多かったのは、「ある」(45%)である。「秘密保持条項で十分と考えており、ない」との回答と併せると81%に達し、逆に十分な対策を講じていないと感じている企業は前回調査時より14ポイント減少している。その理由は、中国における模倣品等の知的財産権侵害を抑制したい、とのライセンサーの意識が浸透しライセンス契約の内容やその運用に反映されてきていることにあるものと推察される。

ライセンシーに情報漏洩防止義務を課しているケースにつき、具体的にどのような対応をとっているかを確認したところ、**図15**に示す通り、「ノウハウへアクセスする従業員への宣誓書提出義務」(27%)が前回調査から21ポイント増加している。従業員に対して宣誓書提出を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

義務化する傾向が増大したのは、中国の雇用の流動性を考慮しての対応策ではないかと考えられる。

質問14. ノウハウライセンスについて、特に情報漏洩防止義務を具体的に定めていますか？

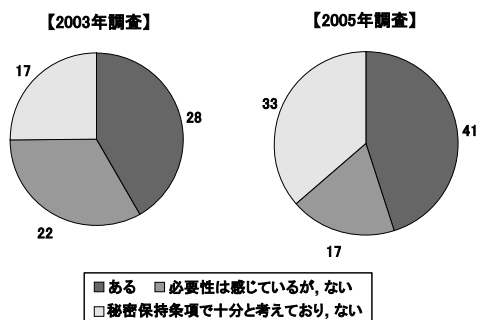


図14

質問15. 秘密漏洩防止義務の具体的な内容は？

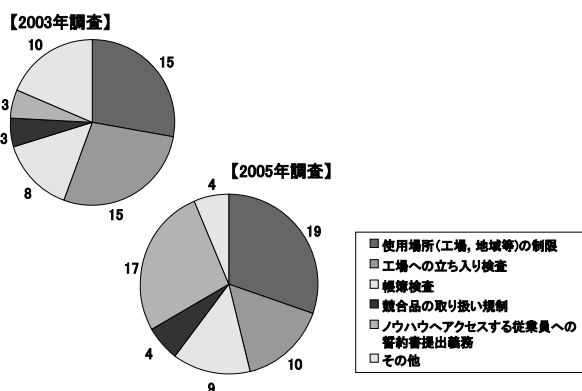


図15

(11) ライセンス締結に際し問題となった事項

「ライセンス締結に際して問題となった事項」の全体件数は、図16に示す通り、前回調査の39件に対して今回の調査でも38件とほぼ同件数の結果となったが、ライセンス全体件数は増加していることから、ライセンス締結に際しての問題自体は減少傾向にあるものと推定される。ただし、その中で、「送金規制、ロイヤルティ率の規制」が前回調査と比較して件数が増加する傾向を示したため、「送金規制、ロイヤルティ率の規制」について追跡調査を行った。

その結果、「ロイヤルティ率の規制」については、ロイヤルティ率を純販売価格の5%以内とするように指導を受けたという回答が4件あり、旧条例の廃止とともに効力を失ったとされる内規が依然として参考にされている可能性を確認した。

もう一方の「送金規制」に関しては、必要書類（技術輸入許可証あるいは技術輸入契約登録証、技術輸入契約書、企業所得税及び営業税の納税証明書、免税証明書等）の不備により送金ができなかった事例を確認したが、書類を調えることで解消しており、実際に送金規制を受けたという事実は、追跡調査の範囲内では確認できなかった。

質問16. ライセンス締結に際して問題となった事項は？

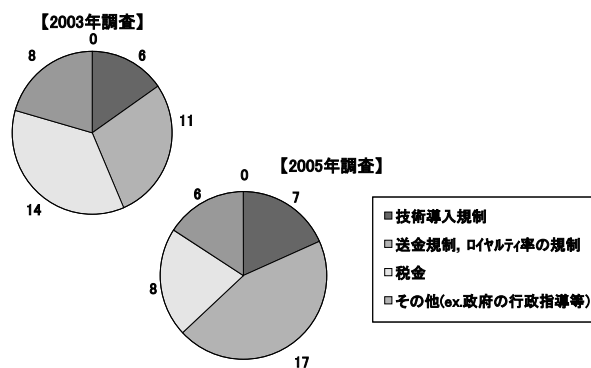


図16

(12) ライセンス締結後に問題となった事項

ライセンス契約の締結後において問題となった事項について確認したところ、図17に示す通り、全体件数は27件となっており、前回調査結果の34件から減少している。

特に、ライセンス技術の保証問題については、「追加の技術指導/改良技術の提供」が11件から7件、さらに「ライセンス対象技術に関するライセンサーの保証」に至っては10件から1件へと大幅に減少している。

一方、増加傾向にあるものとしては、「対価(ライセンス料)の支払い」が7件と、前回調

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

査結果の3件と比較して増加しており、昨今、中国において増加している中国企業からの債権回収問題が、ライセンス契約においても例外ではなく、今回の調査結果にも現れていることが窺われる。

質問17. ライセンス締結後に問題となった事項は？

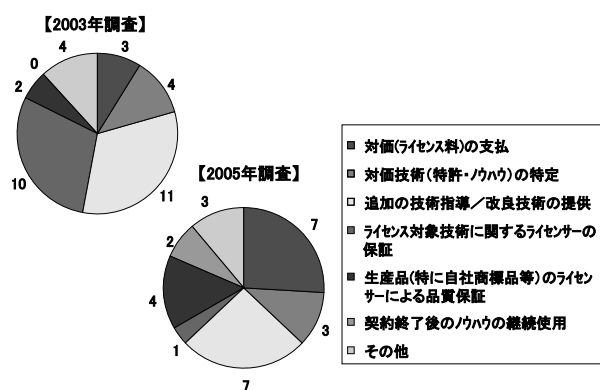


図17

3.3 まとめ

技術ライセンスに関する今回の調査結果をまとめると以下ようになる。

(1) 中国における技術ライセンスの状況

ライセンス契約件数の動向及び今後の予測については、前回調査から大きな変化は見られなかったが、今後の予測として件数の「減少」と回答した企業はほとんどなかったことから、少なくとも現状のライセンス状況は維持されると窺われる。

(2) ライセンスの相手先・交渉の進め方等

ライセンス相手先として100%子会社が増加しており、そのことがライセンスの動機及び準拠法等に影響を与えていることが窺われた。

ライセンス締結に関する問題としては、前回調査と比較してライセンス技術保証に関する問題が減少しているのに対して、「送金規制、ロイヤルティ率の規制」及び「対価の支払い」に

関しては増加傾向にあることが判明した。「送金規制」については、必要書類の不備が理由であった事例も報告されたことから、事前に必要書類を各社できる限り準備しておくことが望ましい。対価の支払いに関する問題については、今後も増加することが想定されることから、契約先の信用度を考慮した支払方法を検討する等の対策が必要と思われる。

4. R&Dの実態について

昨今、中国において、海外企業の独資によるR&Dセンター設立が許可されたこと等もあって、海外企業によるR&D活動が活発化してきている。現在、日本企業にとって中国の位置づけは、安い労働力を目的とする「製造拠点」に加えて、膨大な人口を背景とした「消費地」、更には中国マーケットの需要に対応した製品の開発や、優秀な頭脳を活用する「R&D拠点」へと変化しつつあるといわれている。このことを検証すべく、さらには現在の日本企業各社の中国R&D活動における問題点を把握すべく、以下のアンケートを実施した。

4.1 中国でのR&D活動の動向

(1) R&D活動の実施～現状及び傾向

図18に示す通り、R&D実施の有無については、回答企業のうち36%が実施しており、実施予定を含めると55%の企業が実施有となった。業界別に見ると、電機、電子・通信業界が最も比率が高く、63%の企業が既に実施しているという結果となった。この業界においては、中国マーケットの急速な成長に伴い、需要に対応した製品やサービスを提供するための製品カスタマイズのための研究開発が他の業界よりも先んじて実施されていたことがわかる。

図19に示す通り、R&Dを開始した企業数は2000年に急増し、それ以降も増加傾向にある。これは、2000年以降日本企業にとって中国の重

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

質問18. 中国においてR&Dを行っていますか？

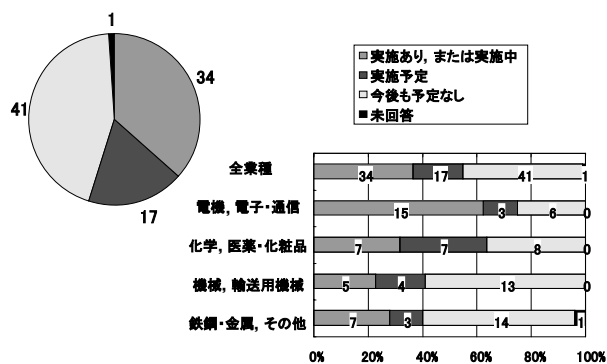


図18

質問20. (質問18で「実施あり、または実施中」とお答え頂いた方へ) 現時点でのR&Dの傾向は？

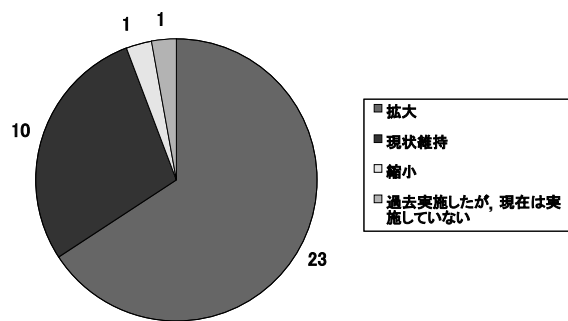


図20

質問19. (質問18で「実施あり、または実施中」, 「実施予定」とお答え頂いた方へ) いつ頃始めましたか？

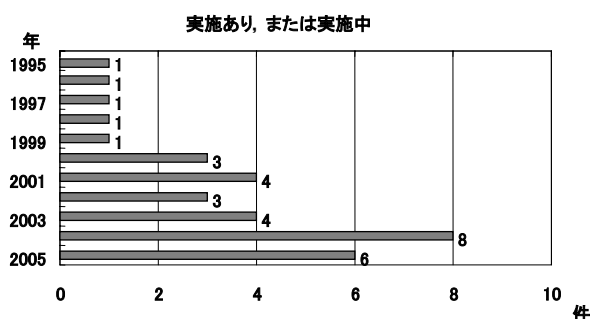


図19

要性が加速度的に高まった(単なる「製造拠点」から「R&D拠点」へという役割期待の質的変化も含め) ことに加え、2000年以降独資企業の設立が広く認められるようになり、中国での100%資本のR&D拠点も現実のオプションとなったことの影響も少なくないと考えられる。

図20に示す通り、現在R&Dを実施している企業において、今後のR&Dの傾向について尋ねたところ、拡大傾向との回答が66%、現状維持も含めるとほぼ100%となった。中長期的にも、各企業の中国R&D活動への積極的な姿勢が窺える。

(2) R&D活動の主目的

図21に示す通り、R&D活動の目的については、「中国マーケット向けの商品開発」を目的

としたR&Dが47%と最も多く、従来主流を占めていたと思われる「日本(親会社)で実施される研究開発の補助」を大きく上回った。一方、「基礎研究」や「グローバルな中核的研究開発」とする目的も23%存在した。まさに日本企業が中国を、単なる製造拠点としてではなく、膨大な中国市場を視野に入れた商品開発の拠点、更には高度な頭脳の拠点としてとらえつつあることを示している。

業界別では、機械、輸送用機械業界において、中国のR&Dを日本(親会社)で実施される研究開発の補助を目的としている割合が高いということがわかった。後で述べる通り、自動車業界では中国との合弁で設立したR&D拠点を比較的多く有することにも起因するかもしれない

質問21. R&Dの目的は何ですか？(複数回答可)

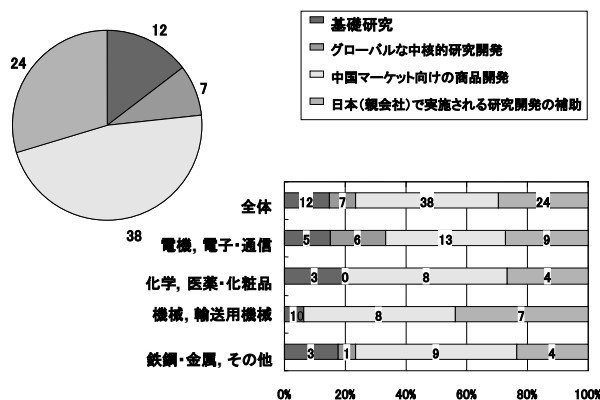


図21

(下記4. 2. (2) 参照)。

4. 2 R&D拠点について

(1) R&D拠点の有無

図22に示す通り、中国にR&Dを行う自社の拠点、例えば「中国R&Dセンター」のようなものを有するか、という質問に対しては、「ある」と回答した企業が60%を超えた。なお、ここでいう自社のR&Dの拠点とは、必ずしもR&D専用の独立した施設でなくともよく、工場等の製造拠点に併設されたものも含む趣旨である。今回は正確な数字は得られなかったものの、「中国××工場内R&Dセンター」のような製造拠点に併設されたR&D拠点は実際にはかなりの割合を占めるものと思われる。

質問22. R&Dを推進する拠点（製造拠点内にある場合も含む）が中国にありますか？

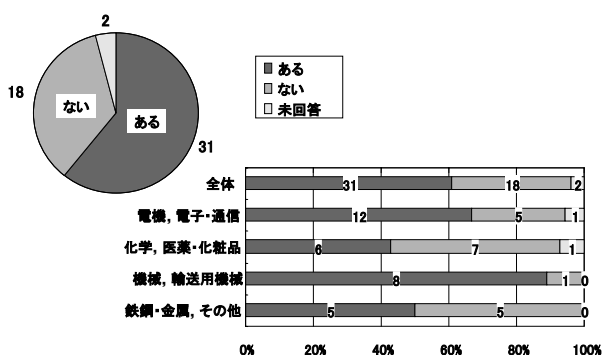


図22

(2) R&D拠点の形態

図23に示す通り、中国に有するR&Dの拠点の資本形態は、そのほとんどが経営権を握る子会社（資本比率50%以上）であり、さらにその大多数、すなわち全体の73%が100%子会社、いわゆる独資であった。

後述するR&Dの相手先や共同研究開発や委託研究開発の条件にも深く関連してくると思われるが、中国において外資独資企業法が改正されて独資子会社の設立が広く認められるようになった2000年以後（業種によって時期は異なる）

る）、独資子会社の形態で製造拠点に加えR&D拠点をも設置し、完全子会社であることのメリットを十分享受した形で中国でのR&D活動の拠点として活用して行く方向性が促進されていると考えられる。

なお、回答中、自動車等の機械製造企業において独資以外の形態（資本比率50%以上及び50%未満の合弁形態）が比較的多く見られたのは、自動車業界においては、中国における産業政策の一環として中国との合弁製造拠点内へのR&D拠点の設置を求められたことに起因する（2004年5月21日付け「中華人民共和国国家発展改革委員会令第8号」）ものと思われる。

質問23. R&D拠点の設立形態（出資比率）は？（複数回答可）

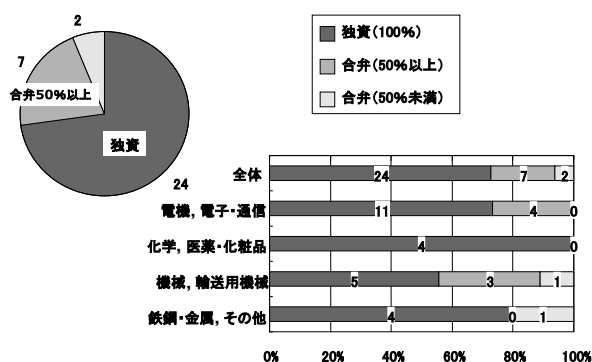


図23

(3) R&D拠点における情報管理

図24に示す通り、自社のR&D拠点を有している企業に対し「製造拠点からR&D拠点へに移行した、もしくは、製造拠点に加えてR&D拠点が追加・新設されたことにより、技術情報・ノウハウの保護の観点で変化はないか」との質問をしたところ、当初の想像とやや異なり、75%もの企業が「特に従来から変化なし」との回答であった。前述のライセンス規制に関する回答（上記3. 2. (10) 参照）も併せて考えると、企業によって意識のばらつきはあるものの、情報管理に対する意識の高い企業は製造拠点において既に実効性の高い対策を講じており、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

R&D拠点であってもこれで十分である、と考えているように見受けられる。ただし、これがR&D拠点に特有の技術的に高度の専門性等を正当に勘案した結論であるか、それとも従来の製造拠点における情報管理の延長線としての「当面の対策」方針であるのか、あるいは実務面での対応能力に制約がある現状に起因するのか、等々結論付けるのはやや早計であろう。今後、まさに中国R&D拠点に対する役割期待が現実のものとしてますます重要視され、それに対応して日本との間で最先端の技術情報をも開示し合うようになったとき、この問題が再び現実味を帯びてくることも考えられる。

質問24. 製造拠点からR&D拠点へ転換の際に、情報管理の面で変化がありましたか？

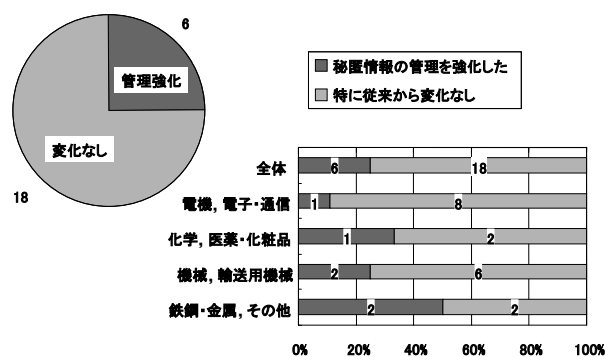


図24

4. 3 R&D契約について

(1) R&D契約の形式

R&Dを行う場合の契約形式については、図25に示す通り、委託研究開発契約（48%）、共同研究開発契約（25%）と、委託研究開発契約が全体の半数近くを占めていることがわかった。また、R&D拠点での独自研究開発を行っているとの回答が24%あったが、これらはR&D拠点が特に第三者と研究開発契約を締結することなく実施しているR&D活動を意味するものと考えられる。

質問25. R&Dを行う（予定を含む）場合の形態は？（複数回答可）

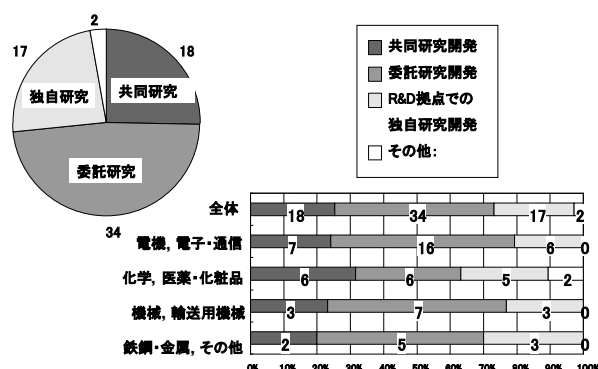


図25

(2) R&D契約の相手先

図26に示す通り、R&Dの委託研究開発契約または共同研究開発契約を締結したと回答した企業の契約の相手先としては、「大学・国家機関等」（46%）、自社の「R&D拠点」（28%）、「中国企業」（20%）と続き、大学・国家機関が全体の半数近くを占めていることがわかった。

質問26. R&Dの相手先は？（複数回答可）

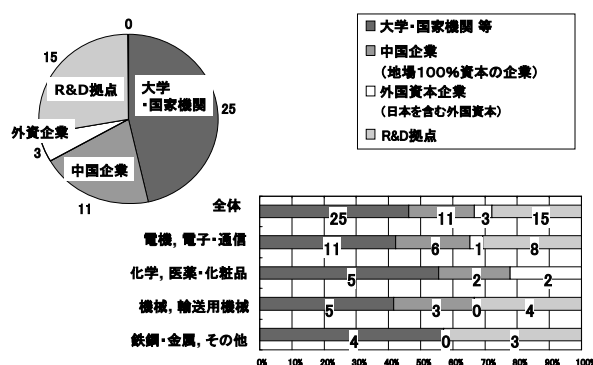


図26

(3) R&D契約の政府登録

図27に示す通り、新条例に基づくR&D契約の登録については、38%が「登録した」と回答している。「登録した」と回答した企業を業種別に分類すると、電機、電子・通信業がその6割を超える結果となった。一方、「登録していない」と回答した企業については、業種による

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

質問27. <技術輸出入管理条例への対応>共同研究開発や委託研究開発の契約を登録されましたか？

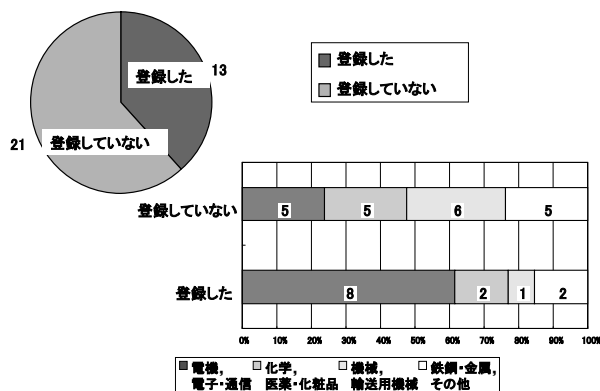


図27

差異は認められなかった。「登録した」と答えた場合の、その主な理由は、図28に示す通り、「成果の持ち出し（中国から日本へ）が技術輸出に該当し、新条例の適用を受けると自ら判断した。」（主に電機、電子・通信業界）、「弁護士に必要と言われた。」（業界による差異なし）、「中国政府当局に問い合わせ、当局より必要と言われた。」（主に電機、電子・通信業界）であった。一方、「登録していない」と答えた場合の、その主な理由は、図29に示す通り、「共同研究開発契約や委託研究開発契約は、「新条例」

質問28.（質問27で「登録した」とご回答頂いた方へ）その理由をお教え下さい（複数回答可）。

登録した理由	業種	電機、電子・通信	化学、医薬・化粧品	機械、輸送用機械	鉄鋼・金属、その他	合計
成果の持ち出し（中国から日本へ）が技術輸出に該当し、条例の適用を受けると自ら判断した。		5	0	0	1	6
弁護士に必要と言われた。		2	2	1	0	5
中国政府当局に問い合わせ、当局より必要と言われた。		3	0	0	1	4
その他：（R&D優遇措置を受ける為）		1	0	0	0	1

図28

の適用を受けないと自ら判断した。」（全業種で最多）、「弁護士に不要と言われた。」であった。登録の可否判断理由に関して、条例の適用を受ける／受けないを、自らの判断で行ったというところで見解が分かれた結果となった。

こうした状況を勘案するに、登録については個別・具体的に現地の弁護士等に確認した上で将来のリスクも踏まえて対応・判断することが望ましいと考えられる。

(4) 契約における成果の帰属

R&D契約における成果の帰属については、共同研究開発と委託研究開発それぞれに関して、契約相手の業種（大学・国家機関、中国企業、外国資本企業、R&D拠点、その他）別に、成果の帰属先（自社側、相手側、共有、発明者主義、その他）を調査した。その結果、図30に示す通り、共同研究開発においては共有が70%を占め、次いで発明者主義が20%を占める結果となり、共有が一般的な傾向として採用されていることがわかった。一方、委託研究開発では、自社側に帰属させる場合が60%（相手がR&D拠点の場合は75%）を占める結果となっ

質問29.（質問27で「登録していない」とご回答頂いた方へ）その理由をお教え下さい（複数回答可）。

登録していない理由	業種	電機、電子・通信	化学、医薬・化粧品	機械、輸送用機械	鉄鋼・金属、その他	合計
条例の存在を知らなかった。		0	1	1	2	4
共同研究開発契約や委託研究開発契約は、条例の適用を受けないと自ら判断した。		3	1	2	2	8
弁護士に不要と言われた。		1	0	1	1	3
中国政府当局に問い合わせ、不要と言われた。		0	1	0	0	1
その他		1	3	3	0	7

図29

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た。相手が大学・国家機関の場合、委託研究開発でも共有とした割合も多く（40%）見られたのが特徴的である。中国契約法第339条及び第340条によれば、委託研究開発、共同研究開発のどちらにおいても成果の帰属は「契約で特段の定めがある場合を除き発明者に帰属」とあり、実際にもそれに沿った形で、契約の種類、相手方に応じて契約において帰属が定められているようである。

質問30. R&D成果の帰属をどう決めましたか（相手先別に）？

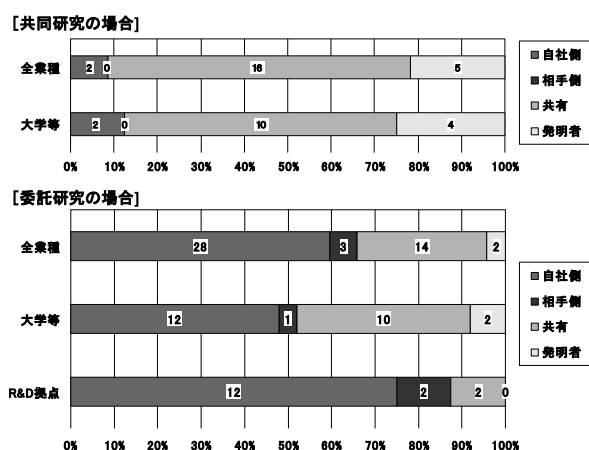


図30

(5) 契約における成果の実施／実施許諾

図31に示す通り、「成果の自己実施について

何らかの制約を受けたか」との問いに対して、回答者の83%から「制約なし」との回答を得た。受けた制約としては、3社（10%）が「相手先への実施料の支払い」を挙げ、1社が「実施国の限定」を挙げた。反対に「成果の相手方の実施について何らかの制約を課したか」との問いに対しては、「制約なし」との回答が全体の46%を占めたが、「自社への実施料の支払い」を課したとの回答が11%、また「実施国の限定」を挙げた回答が14%という結果となった。以上から、日本企業側が実施に際し相手側から制約を受ける例は少ないが、相手側に実施を制約する例はより多い、という傾向が窺える。

図32に示す通り、「成果の第三者への実施許諾において何らかの制約を受けたか」との問いに対しては、全体の59%が「制約なし」と回答した。「許諾に際して相手方の事前承諾を要した」との回答は、30%あった。「成果の第三者への実施許諾において相手方に何らかの制約を課したか」の問いには、11%が「制約を課していない」と回答し、61%が「自社の事前承諾を課した」との回答であった。

実施許諾に関しても制約を受けない傾向にあるが、相手方への制約事例の割合が多い。

その他、成果の実施及び実施許諾それぞれに

質問31. R&D成果の実施に関する制約は？

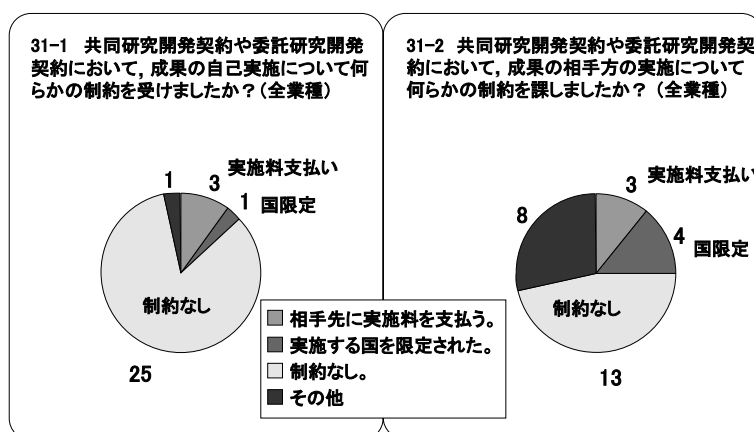


図31

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

質問32. R&D成果の第三者への実施許諾に関する制約は？

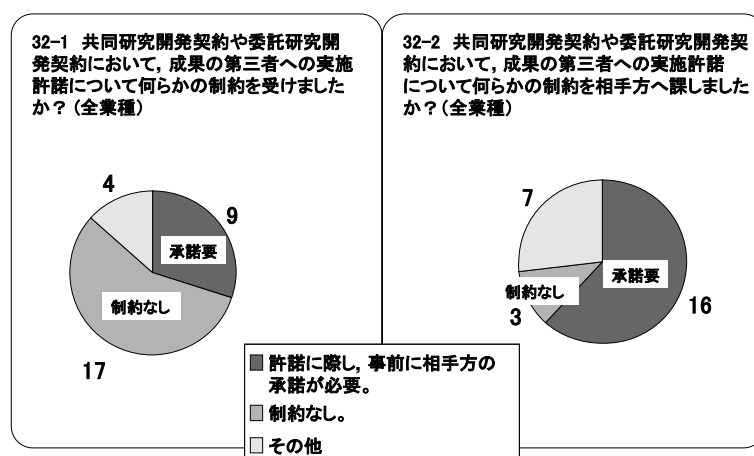


図32

関し、制約を課した事例として「実施可能企業の限定」、「実施条件についての別途協議」、「自社帰属の成果は相手先に実施許諾権を与えない」等の回答があった。

共同研究開発契約のみではなく、自社に成果を帰属させるケースの多い委託研究開発契約も含んでいるため、全体では日本企業側がやや有利（受ける制約は少なく、課する制約は多い）な傾向があるのは合理的と思われる。中国契約法第341条によると、委託研究開発、共同研究開発のどちらにおいても「成果の使用権、譲渡権及び利益の配分方法は、当事者が契約で定めるものとする。」とされており、これを踏まえて、両当事者の意図を反映した成果に関する取り決めがなされていることが窺える。

(6) R&D契約での紛争（トラブル）例

今回の調査では顕著な紛争（トラブル）の事例は報告されていない。R&D成果を中国外に持ち出す際のトラブル事例として「R&D拠点で取得した特許を本社へ移転するには、特許庁手続き以外に商務部の許認可を要し、手続きが煩雑であること」（電機、電子・通信業界）、また、R&D成果の帰属やライセンスに関するトラブル事例として、「中国合弁会社の自己開発

分を実施料から削減するよう要望された」と回答した企業があった。

4.4 まとめ

R&Dの実態調査アンケートの結果をまとめると、以下のようになる。

(1) 中国でのR&D活動の動向

中国が製造拠点に留まらず、R&D拠点としての重要性が高まっていることが判明した。これは2000年以降独資企業の設立が認められたことも要因の一つと考えられる。また、既にR&Dを実施している企業の7割近くが、今後とも拡大傾向にあるとしており、中長期的にも中国R&D活動への積極姿勢が窺われる結果となった。

R&D活動の目的に関しては、中国マーケット向けの商品開発を目的とするものが半数近くあり、中国の巨大マーケットに対して現地での研究開発を指向している傾向が読み取れる。ただし、一部業界（機械、輸送用機械）については、日本でのR&Dの補助を目的とする傾向も見られた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) R&D拠点について

中国に自社のR&D拠点を有している企業が6割を超えていることが判明した。またこれらR&D拠点の資本形態に関しては、独資が全体の7割を超える結果となった。ただし、自動車業界等においては、中国の産業政策の一環として、独資以外の資本形態のものも比較的多く見られる結果となった。

R&D拠点における情報管理の実態は、製造拠点として従来から行っていた施策に特に変更は無いという状況である。

(3) R&D契約について

R&D契約の形式は、委託研究開発が共同研究開発より主流であり、相手先は大学・国家機関が主流というのが現状であった。

R&D契約の政府登録については、登録の可否判断に関して新条例の適用有無を自らの判断で行っている傾向が見られたが、個別・具体的に現地弁護士等に確認した上で対応することが望ましいと考えられる。

契約における成果の取り扱いについては中国契約法の規定を背景として、多くの契約で当事者間の意向を踏まえた合理的な取り決めがなされていることがわかった。

最後に、R&D契約での紛争例については、今回の調査においては顕著な事例は見出せなかった。

5. おわりに

今回、2年ぶりに技術ライセンスに関するアンケートを実施し、過去の調査と比較する中で、新条例が運用においても定着してきているのが随所に窺えた。とは言うものの、実施料率の指導や自由技術の審査等も未だ存在している、というアンケート結果も一方で出ており、以前から指摘されてきた問題が完全に払拭された、と

は残念ながら言えないのが現状である。今後とも、ライセンス規制の実態につき引き続き留意する必要があるようである。

また、今回初めて実施したR&Dに関するアンケートからは、予想通り日本企業各社が製造拠点としてのみならずR&D拠点としても中国に大きな関心を寄せており、かつ実行に着手していることが浮き彫りになった。今回は、未だ中国R&Dに関連する深刻な問題は見出されなかったが、それは現状では未だR&D契約に基づく知的財産等の成果の創出途上である、ということにも起因していよう。近い将来、中国とのR&D契約に基づきR&Dが進行し、成果たる知的財産が続々と創出されるような段階になり、改めて中国企業との間のそれら知的財産の帰属、実施に関する取り決めの実際の運用、または中国より日本への知的財産の移転の実務、等に関して問題や紛争が生じる可能性もありえよう。より長期的視野と問題考察の深さが今後は求められると思われる。

最後に、アンケートにご協力いただいた企業各社に改めてお礼申し上げるとともに、本調査結果を会員各社の中国ビジネスにおけるライセンス契約及びR&D活動にお役立ていただければ幸いである。

注 記

- 1) ライセンス委員会第1小委員会「中国のライセンス規制の調査研究」, 知財管理, Vol.53, No.10, pp.1635~1656 (2003)
- 2) ライセンス委員会第1小委員会「中国のライセンス規制の調査研究(第2回)」, 知財管理, Vol.54, No.11, pp.1687~1696 (2004)
- 3) 「模倣対策マニュアル中国編」(日本貿易振興会投資交流部) pp.18~26 (2000年3月)
- 4) 「模倣対策マニュアル中国編」(日本貿易振興機構 経済分析部) p.23 注釈22 (2005年3月)

(原稿受領日 2006年12月15日)